

BG-402 型曝光机

BG-402 曝光机主要用于中小规模集成电路、声表面波器件、LED 和其它各种半导体元器件制造工艺中的对准及曝光。

主要技术特点：

※ 对准精度高，漂移小。精密楔形误差补偿机构实现找平，找平力小，延长掩模版使用寿命。Z 向采用空气轴承导向，气动驱动，实现了找平与分离的自动控制。在 X、Y 方面可进行大范围扫描观察。

※ 采用柱体蝇眼透镜和高能力集光的椭球反射镜等精密光学件，具有较高的光强、均匀性、光学分辨率。

※ 可进行单视场或双视场切换，提高对准效率和套准精度，同时兼容 CCD 成像显示功能。

※ 电气控制采用可编程控制器（PLC）、LCD 显示屏，操作方便，汞灯电源易于触发，可靠性高。该设备的关键件采用进口或专业厂家制造，气动元件采用 SMC 的产品，提高了设备的稳定性、可靠性，同时提供个性化服务。



主要技术指标：

- 工作台行程：
 - X/Y：±5mm（粗动）
 - ±0.1mm（微动）
 - θ：±5°
 - 扫描范围：30mm×30mm
 - Z 向行程：24mm
- 掩模尺寸：Max5"×5"
- 基片尺寸：Max φ4"
- 基片与掩模微分离间隙：0~0.05mm

- 曝光系统：采用 350W 超高压汞灯
- 曝光分辨率：1.5um（真空接触）
- 曝光时间：0~999s 连续可调
- 曝光面积：φ110mm
- 曝光不均匀性：±4%

- 分离视场显微镜



总倍率：100×（50× 可选）

调焦范围：8mm

物镜分离距离：28~90mm

所需设施：

输入电压： ~220V±22V 50Hz±1Hz

整机功率： 1.0kW

压缩空气： 0.5~0.7MPa

氮气： 0.2~0.4MPa

真空： -0.08~-0.1MPa

体积及重量：

外形尺寸：

950mm×1000mm×1520mm

重量： 400kg